

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年11月18日(18.11.2021)



(10) 国際公開番号

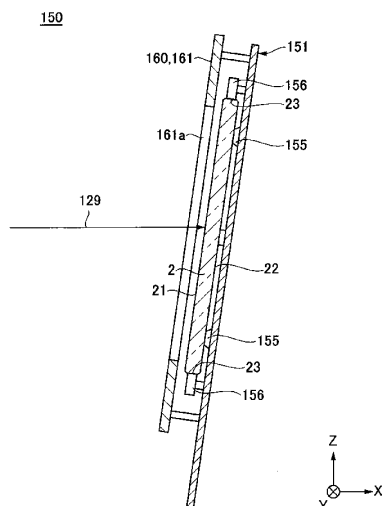
WO 2021/229968 A1

- (51) 国際特許分類:
C03C 17/36 (2006.01) G03F 1/60 (2012.01)
C03C 23/00 (2006.01) G03F 7/20 (2006.01)
G03F 1/24 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/015071
- (22) 国際出願日: 2021年4月9日(09.04.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-084728 2020年5月13日(13.05.2020) JP
- (71) 出願人: A G C 株式会社 (AGC INC.) [JP/JP];
〒1008405 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 奈良 拓真 (NARA, Takuma); 〒9630215
福島県郡山市待池台一丁目8番地 A G C エレクトロニクス株式会社内 Fukushima (JP). 田村 昌彦 (TAMURA, Masahiko); 〒9630215 福島県郡山市待池台一丁目8番地 A G C エレクトロニクス株式会社内 Fukushima (JP).
- (74) 代理人: 伊東 忠重, 外 (ITO, Tadashige et al.);
〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 16階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: PROCESSING METHOD AND PROCESSING DEVICE FOR GLASS SUBSTRATES, AND PRODUCTION METHOD FOR EUVL MASK BLANKS

(54) 発明の名称: ガラス板の加工方法、及び加工装置、並びにEUVL用マスクブランクの製造方法

【図7】



(57) Abstract: This processing method for glass substrates comprises: irradiating a first main surface of a glass substrate with a gas cluster in the form of a beam; moving the glass substrate so as to move the irradiation point of the gas cluster on the first main surface of the glass substrate; and using a shielding part that moves along with the glass substrate to block any anticipated fluid matter that would form defects on at least one of an end surface and a second main surface that faces the opposite direction of the first main surface of the glass substrate.

(57) 要約: ガラス板の加工方法は、ビーム状のガスクラスタをガラス板の第1主面に照射することと、前記ガラス板の前記第1主面における前記ガスクラスタの照射点を移動させるべく、前記ガラス板を移動させることと、前記ガラス板と共に移動する遮蔽部で、前記ガラス板の前記第1主面とは反対向きの第2主面及び端面の少なくとも1つに欠陥を形成する予定の流動物を遮ることと、を有する。

[続葉有]

WO 2021/229968 A1

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))